

**ABSTRACT OF THE DISCLOSURE**

微細パターンを有する光学素子を形成するための光学素子加工方法であって、光学素子に対応し、被描画層を含む基材に、所定のパターンを形成するための描画ステップを有し、前記被描画層が曲面を有するとともに、前記被描画層に対して電子ビームを照射することにより、前記所定のパターンの描画を行う。

10000638 000100